

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成30年6月21日(2018.6.21)

【公表番号】特表2017-515907(P2017-515907A)

【公表日】平成29年6月15日(2017.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2017-022

【出願番号】特願2017-512434(P2017-512434)

【国際特許分類】

C 07 D 499/87 (2006.01)

C 07 F 7/18 (2006.01)

A 61 K 31/431 (2006.01)

A 61 P 31/04 (2006.01)

【F I】

C 07 D 499/87

C 07 F 7/18 V

A 61 K 31/431

A 61 P 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月14日(2018.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

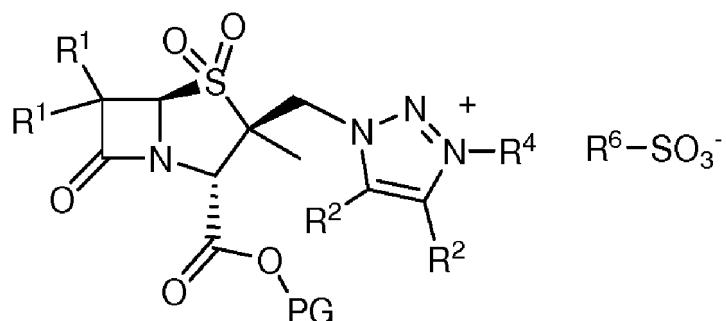
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式(I II a) :

【化1】



式 (IIIa)

(式中、

R¹は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁~5アルキル、C₂~5アルケニルおよびC₂~5アルキニルから選択される；

R²は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁~5アルキル、C₂~5アルケニルおよびC₂~5アルキニルから選択される；

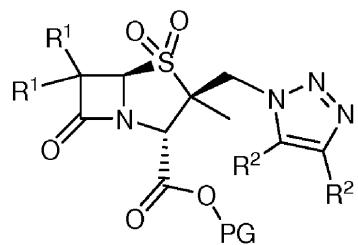
R⁴はC₁~5アルキルである；ならびに

R⁶はC₁~5フルオロアルキルである；ならびに

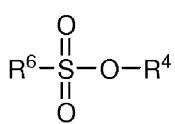
PGは保護基である)の化合物の製造方法であって、式(I II a)の化合物を式(VI)

I I) :

【化 2】



(IIa)



(VIII)

の化合物と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項 2】

P G が式 $S i R^{3-3}$ の基であり、ここで、 R^{3-} が、各場合において、独立して、 C_{1-10} ヒドロカルビルまたは C_{1-5} アルコキシから選択される、請求項 1 記載の製造方法。

【請求項 3】

R^{3-} が、各場合において、独立して、 C_{1-5} アルキル、 C_{1-5} アルコキシ、フェニルおよびフェニル- C_{1-4} アルキルから選択される、請求項 2 記載の製造方法。

【請求項 4】

R^4 がメチルである、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の製造方法。

【請求項 5】

R^6 が C_{1-5} ペルフルオロアルキルである、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項記載の製造方法。

【請求項 6】

R^6 がトリフルオロメチルである、請求項 5 記載の製造方法。

【請求項 7】

極性非プロトン溶媒中で反応を行う、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項記載の製造方法。

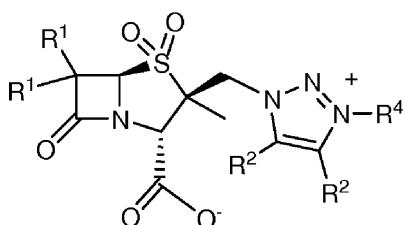
【請求項 8】

10 以下の温度で反応を行う、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項記載の製造方法。

【請求項 9】

式 (I V) :

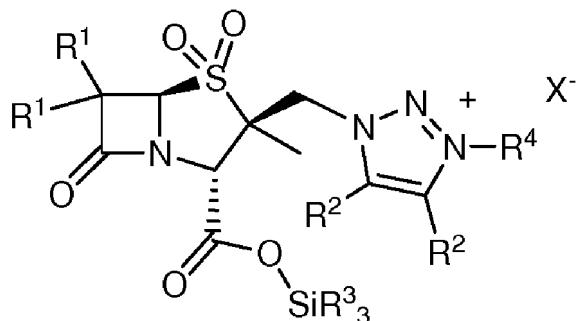
【化 3】



(IV)

(式中、 R^1 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 C_{1-5} アルキル、 C_{2-5} アルケニルおよび C_{2-5} アルキニルから選択される； R^2 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 C_{1-5} アルキル、 C_{2-5} アルケニルおよび C_{2-5} アルキニルから選択される；ならびに R^4 は C_{1-5} アルキルである) の化合物の製造方法であって、式 (I I I)

【化4】



(III)

(式中、 X^- はアニオンであり、各 R^3 は、独立して、 $C_{1\sim10}$ ヒドロカルビルおよび $C_{1\sim5}$ アルコキシからなる群から選択される)の化合物を2-エチルヘキサノアート塩と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項10】

2-エチルヘキサノアート塩が金属2-エチルヘキサノアートである、請求項9記載の製造方法。

【請求項11】

金属がアルカリである、請求項10記載の製造方法。

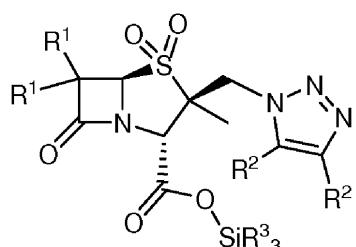
【請求項12】

式(III)の化合物を2-エチルヘキサノアート塩の溶液に加える、請求項9~11のいずれか1項記載の製造方法。

【請求項13】

式(I) :

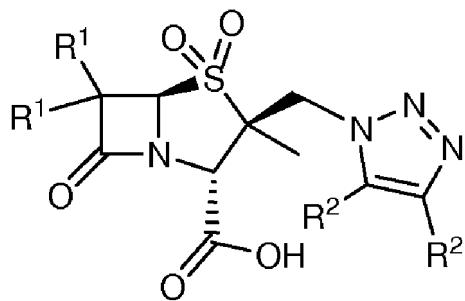
【化5】



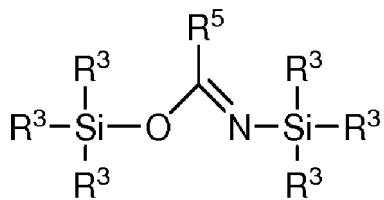
(II)

(式中、 R^1 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 $C_{1\sim5}$ アルキル、 $C_{2\sim5}$ アルケニルおよび $C_{2\sim5}$ アルキニルから選択される； R^2 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 $C_{1\sim5}$ アルキル、 $C_{2\sim5}$ アルケニルおよび $C_{2\sim5}$ アルキニルから選択される；ならびに R^3 は、各場合において、独立して、 $C_{1\sim5}$ アルコキシおよび $C_{1\sim10}$ ヒドロカルビルから選択される)の化合物の製造方法であって、式(I)の化合物を式(V)

【化6】



(I)



(V)

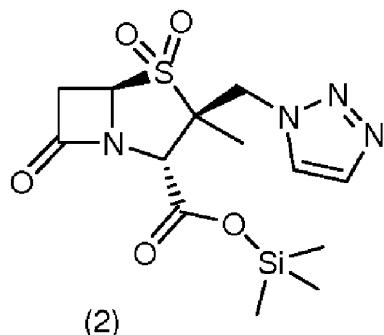
(式中、 R^5 は $C_{1\sim 5}$ アルキルである)の化合物の1モル当量未満と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項14】

R^3 は、各場合において、独立して、 $C_{1\sim 5}$ アルキル、フェニルおよびフェニル-C_{1~4}アルキルから選択される、請求項13に記載の方法。

【請求項15】

式(I)の化合物は、式(2)

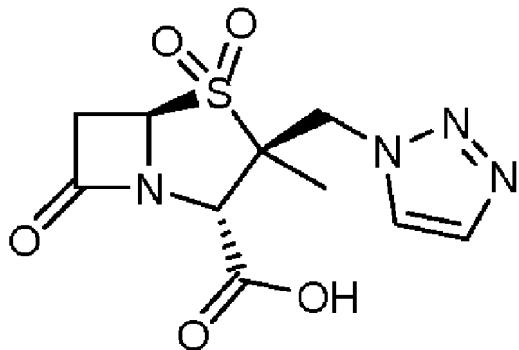


(2)

を有する、請求項14に記載の方法。

【請求項16】

式(I)の化合物は、式(1)



(1)

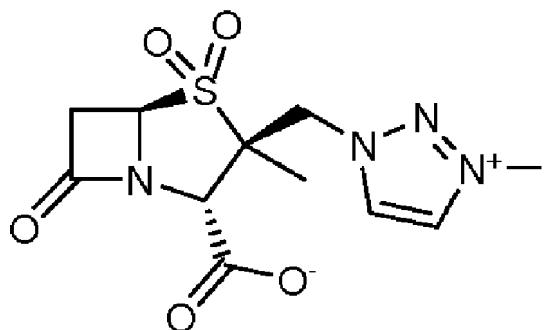
を有する、請求項13に記載の方法。

【請求項17】

式(Ⅴ)の化合物は、N,O-ビストリメチルシリルシリルアセトアミドである、請求項13に記載の方法。

【請求項18】

式(IV)の化合物は、式(4)

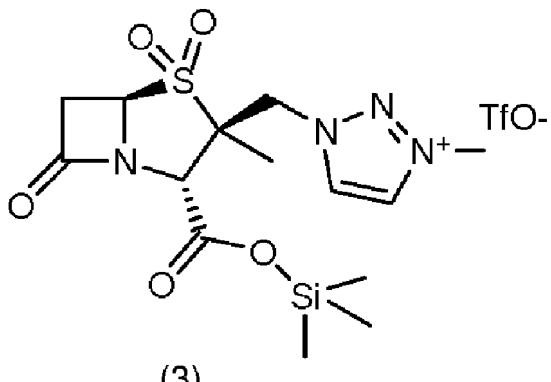


(4)

を有する、請求項9に記載の方法。

【請求項19】

式(III)の化合物は、式(3)



(3)

を有する、請求項9に記載の方法。